

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成24年7月5日 (2012.7.5)

【公開番号】特開2011-237411(P2011-237411A)

【公開日】平成23年11月24日 (2011.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2011-047

【出願番号】特願2011-81804(P2011-81804)

【国際特許分類】

G 0 1 N 21/21 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

G 0 1 B 11/06 (2006.01)

G 0 1 N 15/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/316 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/21 Z

H 0 1 L 21/66 N

G 0 1 B 11/06 Z

G 0 1 N 15/08 H

H 0 1 L 21/316 X

H 0 1 L 21/316 G

【手続補正書】

【提出日】平成23年4月28日 (2011.4.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定圧力及び所定温度の加圧可能な部屋に配置された基板上に形成されている部材の間隙率を求める方法において、

上記部屋にガス物質を導入する工程と、

少なくとも一つの偏向解析測定を行ない、上記所定の圧力及び上記所定の温度における光学的特性を求める工程と、

上記部材の間隙率を計算する工程とを有することを特徴とする方法。

【請求項 2】

基板上に形成された部材の間隙率を求める装置であって、

内部に上記基板を配置可能な加圧可能な部屋と、

上記部屋の温度を所定値に固定する温度制御要素と、

上記部屋の圧力を変化させるポンプと、

ガス物質を導入する供給部と、

上記部屋に上記部材が配置されているとき、上記部材の光学的特性を求める偏向解析器と、

少なくとも第 1 の制御可能な要素と、少なくとも第 2 の制御可能な要素とを有し、上記第 1 の要素は上記ポンプと上記部屋との間に配置されて上記部屋の圧力を正確に調整でき、上記第 2 の要素は上記供給部と上記部屋との間に配置されて上記部屋に導入される上記ガス物質の量を正確に制御できる装置。